

⑫ 公開特許公報 (A)

昭62-297451

⑬ Int. Cl.⁴
C 23 C 4/04
4/18識別記号
厅内整理番号
6686-4K
6686-4K

⑭ 公開 昭和62年(1987)12月24日

審査請求 未請求 発明の数 2 (全8頁)

⑮ 発明の名称 セラミック溶射材料および溶射方法

⑯ 特願 昭61-141186

⑰ 出願 昭61(1986)6月16日

⑱ 発明者 成田 雄司 尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式会社中央技術研究所内

⑲ 発明者 鈴木 隆夫 尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式会社中央技術研究所内

⑳ 出願人 住友金属工業株式会社 大阪市東区北浜5丁目15番地

㉑ 代理人 弁理士 溝上 満好 外1名

明月 糸田

(産業上の利用分野)

1. 発明の名称

セラミック溶射材料および溶射方法

2. 特許請求の範囲

(1) Al_2O_3 、 ZrO_2 、 Cr_2O_3 、 TiO_2 もしくは NiO 系の酸化物単体のセラミック粉末に、酸化物中の陽イオンと同一の金属元素粉末を、前記セラミック粉末100 vol %に対して1~10 vol %添加して成ることを特徴とするセラミック溶射材料。

(2) 事前処理を含む一連のセラミック溶射過程において、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 Cr_2O_3 、 TiO_2 もしくは NiO 系の酸化物単体のセラミック粉末に、酸化物中の陽イオンと同一の金属元素粉末を、前記セラミック粉末100 vol %に対して1~10 vol %添加して成るセラミック溶射材料の溶射時あるいは/及び溶射直後に基材を550~200°Cに保持しつつ、皮膜表面を1300°C未満で一旦加熱処理することを特徴とするセラミック溶射方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、プラズマガンを用いたセラミック溶射に使用するセラミック溶射材料およびそのセラミック溶射材料を用いて溶射する方法に関するものである。

(従来の技術およびその問題点)

金属材料への溶射によるセラミック被覆は、材料の耐熱性、断熱性及び高温下の耐食性を向上させるための有力な手法であり、近年、エネルギー有効利用等に関連した種々の装置部材に適用されている。しかし、適用拡大と共に使用条件は苛酷化し、そのために皮膜の緻密性と結合性をさらに向上させる必要がある。とくに、これら緻密性と結合性を同時に満たし、被覆効果を持続させる点で、セラミック皮膜自体の密着力を高める必要がある。

このため、従来から溶射材粒子の溶融状態や液滴としての飛行状態について、溶射火炎の形成条件(例えば熱量や運動量)、施工条件(例えば溶射距離)の機器改善や方法改善の面で改良が進め

られてきた。

また、溶射時に飛行する液滴は、基材（金属材料）上で積層して皮膜を形成するが、個々の液滴は一種のインターロック状態で基材や積層膜（1個の液滴からなる薄膜の仮称）に結合すると言われており、このインターロック状態を改善することが重要である。即ち、溶射におけるインターロック状態とは、単に評価指針である密着力の背景をなすものではなく、個々の液滴が形成する積層膜の緻密性と結合性の根幹をなす組織形態である。

このインターロック効果を高めるため、従来はセラミック溶射に関して以下の方法が行なわれていた。

（従来例1）

ショットブロストによる基材面の粗面化あるいは／及び有機溶剤による洗浄（第2図）。

しかし、このような方法ではセラミック層1と基材2間の熱物性差（熱歪みの発生）により、剥離しやすい。

（従来例2）

二次加工するので、処理できる基材形状等の制約と、経済性の点で汎用性にかける。とくに、セラミック層1が緻密層5と未処理層6の二層を形成するので、セラミック層1自体の密着力向上は達成できない。

（従来例5）

溶射材料（粉体粒子）の表面をニッケルメッキして熱処理することによって例えば $ZrO_2-NiO-Ni$ 系複合基粒子を得、これを溶射する方法（日本溶射協会第33回学術講演大会概要集、第6図）。

しかし、この方法は皮膜中に中間生成物（例えば $MgNiO_2$ ）を二次形成するもので、二次生成物が結合層として皮膜を強化するが、セラミック皮膜本来の特性である耐熱性の点で劣る。

このように従来法では、一定の改善効果が認められて個々に使用されているが、苛酷化する使用条件に必ずしも適合しない。

そこで、本発明者等は種々のセラミック溶射皮膜の組織形態を詳細に検討した結果、金属粉とセラミック粉の混合物を溶射することによって、所

上記従来例1の熱歪みを緩和する目的でNi基、Co基の合金を事前に下地溶射（アンダーコート）する方法（第3図）。

しかし、この方法では熱サイクルを与えた場合にセラミック層1ではがれ易い。図中3はアンダーコート層である。

（従来例3）

上記従来例2における皮膜内の熱膨張差を緩和するため上記合金とセラミックの混合したサーメット層4を介在させる方法、あるいは、サーメット層4中の積層段階で金属／セラミックの比率を細分化して積層する方法（第4図）。

しかし、この皮膜は金属の介在する積層域で基材2と良好な密着力を得ているのみで、セラミック層1で剥離が進行する。

（従来例4）

セラミック層を溶射形成後、レーザー照射してセラミック表面を緻密化する方法（特開昭59-96273号、第5図）。

しかし、この方法ではレーザー照射機を設置して

要の目的を達成することができることを知見したのである（第1図）。

なお、従来のサーメット溶射材料と呼ばれているものは、例えばNi基、Co基の合金粉とTiN、WC等の炭窒化系セラミック粉との混合粉で、本発明趣旨の酸化物系セラミックとは異なるものである。

また、本発明者等が先に開示した特開昭56-59679号は、材質に関し、窯炉と同系統の補修材料であって、本発明はこれと異なり、膜厚1μ程度の表面被覆を趣旨とする溶射材料である。

さらに、使用前のイニシャルの皮膜として緻密性を高めるためには、皮膜を含む基材の熱処理が有効である。溶射皮膜の熱処理法は一般にフェーリングと言われ、主に自溶性合金の溶射皮膜に施される方法である。従来のこの方法は溶射後再度ガスバーナーで皮膜表面を溶融させ、気孔の密封化と合金成分の基材への拡散を促す方法で、通常800～900℃に加熱放冷する。しかし、このような方法を本発明に係るセラミック皮膜に適用することは以下の理由で不可能である。

- ① 一旦、冷却させた皮膜を急熱急冷するためセラミック層が剥離する。
- ② 皮膜中の残存金属相で急激な酸化を引き起こし、皮膜組織を破壊する。

そこで、本発明方法の検討で上記材料を用い、かつ前処理を含む一連の溶射工程で、基材も皮膜も同時加熱することが有効であることを見い出したのである。

(問題点を解決するための手段)

本発明の第1は、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 Cr_2O_3 、 TiO_2 もしくは NiO 系の酸化物単体のセラミック粉末に、酸化物中の陽イオンと同一の金属元素粉末を、前記セラミック粉末100vol%に対して1~10vol%添加して成ることを要旨とするセラミック溶射材料である。

即ち、これらセラミック、個々の粉末（以下「 Mo_x 」という）に、酸化物中の陽イオンと同一の金属元素の粉末（以下「M」という）を添加混合して本発明の溶射材料は構成されるのである。これらのセラミック粉に同一元素の金属粉を配合す

金属材料である基材あるいはアンダーコート面に濡れ易く、セラミック層の密着を促進する。とくに、溶射粉末の配合量を次のように厳密に調整することによってこれら皮膜の良好な結合状態が得られ、密着性向上がより効果的に達成できる。

Mの添加量を1~10vol%とする。これは Mo_x 100vol%に対する外掛比率で、かつ、 Mo_x 粉の比重（概ね1.0）に対し、それぞれのM粉の比重で換算した値を充当する。1vol%未満の配合では大半が燃焼し尽くし、所要の金属相を含む皮膜は得られないからである。また、10vol%以上では皮膜全体の耐熱性が著しく低下するからである。溶射火炎の条件はセラミックの溶射に主体をおくため、過剰な熱量によってM粉は過熱状態となって多量の気泡を生じせしめる。

一方、溶射に供するM、 Mo_x 粉末それぞれの組成上の純度は、原則として95%以上でなければならない。

M粉の場合、不純成分はC、Fe、Si、Mn、S等

るのは、以下の理由による。

- ① 金属粉の部分的な酸化燃焼により、セラミック粒子の溶融を促す。
- ② 酸化燃焼した金属から微小な、しかも同一組成のセラミック液滴が積層され、セラミック皮膜を緻密化し、結合性が高まる。
- ③ 未酸化あるいは不完全酸化の金属粒子とセラミック粒子とは液滴の状態で互いによく濡れ易い場合もあって、相互に良好なインターロック状態の層を形成する。
- ④ セラミック皮膜中に残存する金属相は相対的に可塑性に富み、しかも溶射積層する凝固過程で隣接するセラミック相に残留圧力を付与し、結合力を高める。
- ⑤ 使用過程あるいは熱処理によって皮膜中残存金属相の溶融と酸化が進行し、皮膜の気孔が減少して結合力が高まり、また、皮膜中セラミックの微小クラックの伸展を防止し結合力を維持する。
- ⑥ 未酸化あるいは不完全酸化の金属粒の液滴は

であり、多くは製造過程で混入し、溶射後所要のセラミック層とは別に酸化物相を作り易い。また、これらが固溶成分であっても、溶射時の酸化過程で吸熱反応やガス化反応を起こすものもあり、皮膜中に欠陥を生ぜしめる。

Mo_x 粉の場合も同様であるが、ただし、固溶体として単一の鉱物学的な相（鉱物相）を形成する範囲内では問題はない。例えば ZrO_2 粉末中の Y_2O_3 成分や CaO 成分等、あるいは Al_2O_3 粉末中の TiO_2 成分は別個の酸化物相とはならず、ある組成範囲でそれぞれの主成分相内の陽イオンとして固溶するので、鉱物相安定性を高めている。もちろん、溶射後にセラミック相中で Zr あるいは Al が付与され固溶度が低下しても諸物性に与える影響はすくなく、むしろ、皮膜としては膜中の金属相とセラミック相とのインターロックによる効果が大きく現われる。

なお、溶射粉末の粒度は下記の範囲内であることが望ましい。

通常、酸化物セラミック粉末の粒度は1.5~

100 μm の範囲にあり、これに対し金属粉の粒度を 5 ~ 50 μm とするのである。

5 μm 未満では溶射時に燃焼飛散し易く、膜形成に所要の相をつくりないからである。また、50 μm 以上では粗大な独立した金属相を形成して点状欠陥を形成し易く、低融劣化を招くからである。特に、金属相の均等な酸化、未酸化相の分散を図る上では、望ましくは Mo_x 粉と M 粉はそれぞれ 40 ~ 80 μm 、10 ~ 20 μm の範囲がよい。

以上のように、本発明ではいわば疑似サーメット皮膜を形成することで、セラミック皮膜としての耐熱性を保持した密着性の高い溶射加工が達成できる。なお、第1図中 10 は疑似サーメット層を示す。

次に、本発明の第2は、事前処理を含む一連のセラミック溶射過程において、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 Cr_2O_3 、 TiO_2 もしくは NiO 系の酸化物単体のセラミック粉末に、酸化物中の陽イオンと同一の金属元素粉末を、前記セラミック粉末 100 vol % に対して 1

~ 10 vol % 添加して成るセラミック溶射材料の溶射時あるいはノズル及び溶射直後に基材を 550 ~ 200 °C に保持しつつ、皮膜表面を 1300 °C 未満で一旦加熱処理することを要旨とするセラミック溶射方法である。

本発明の溶射方法は、一連の溶射工程で基材と皮膜を同時に加熱状態にするのである。基材については 550 °C ~ 200 °C の範囲で溶射前から加熱状態にしてこれを保持する。そして、この状態で皮膜形成した後、さらに皮膜最表面の温度を 1300 °C 未満の範囲で昇熱して冷却し、材料温度が 200 °C に下がった後に全体を放冷するのである。

基材の予熱温度は各部位の平均温度を意味するが、550 °C を超えると熱変質が促進される場合がある。また、200 °C 未満では基材と皮膜間で剥離が生じ易い。

皮膜の表面の温度は M 粉の融点以下で、軟化領域内の温度であり、金属相の急激な酸化を抑制し、同時に基材と皮膜表面の温度差を 1300 °C 未満

に抑えるので剥離防止に効果がある。M 粉の酸化反応作用を勘案すれば、多くは 700 ~ 1000 °C の処理温度で十分に目的は達せられる。

熱処理時の昇降温速度は 1 ~ 5 °C/min に調整することが望ましい。1 °C/min 未満では、作業能率を阻害するからである。とくに、昇温時の酸化速度あるいは降温時の熱歪みの緩和を図るために 5 °C/min 以下にする必要がある。もちろん上記趣旨を留意する必要がない基材の予熱段階や 200 °C 以下の放冷段階では、調整は不要である。また、皮膜の熱処理としては、不必要的熱衝撃を与えない意味で溶射直後に処理開始するのも当然の処理である。

このような熱処理の熱源としては電気炉内雰囲気、赤外線ヒーター、溶射フレーム、あるいは基材の抵抗発熱（特開昭58-216756号）等が有効である。

これら熱源は、基材加熱用と皮膜表面加熱用として、別個にもちいる。熱処理の作業能率を確保する上では、電気炉内で基材を予熱状態にして溶

射加工を施し、溶射ガスフレームで皮膜表面を加熱することが最も有利といえる。本発明では金属粉 M が 10 vol % 以下であるので未溶融で飛散する材料による爆発等の問題は全くない。

以上のような疑似サーメット皮膜を熱処理すれば、熱処理の昇降温過程で皮膜中の残存金属粉 M は徐々に酸化し、微小な Mo_x 相を晶出するので皮膜中気孔が減少し、緻密化したセラミック皮膜を形成でき密着力は低下しない。

もちろん、これら一連の熱処理をしない皮膜についてても、使用温度に対応して表面部分では同等の変化が生じるのでセラミック皮膜としての耐熱性、緻密化に伴う強度保持の点で何ら問題が生じることはない。

（作用）

本発明は、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 Cr_2O_3 、 TiO_2 もしくは NiO 系の酸化物単体のセラミック粉末に、酸化物中の陽イオンと同一の金属元素粉末を、前記セラミック粉末 100 vol % に対して 1 ~ 10 vol % 添加して成るセラミック溶射材料及び事前処理を

含む一連のセラミック溶射過程において、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 Cr_2O_3 、 TiO_2 もしくは NiO 系の酸化物単体のセラミック粉末に、酸化物中の陽イオンと同一の金属元素粉末を、前記セラミック粉末100 vol %に対して1~10 vol %添加して成るセラミック溶射材料の溶射時あるいは/及び溶射直後に基材を550~200°Cに保持しつつ、皮膜表面を1300°C未満で一旦加熱処理するものである為、皮膜の良好な結合状態が得られて密着性が良好となる。

(実施例)

以下本発明によるセラミック溶射皮膜の実施例を示す。

使用した溶射機は粉体外部送給機能を持つプラズマジェットガンで、 Ar 、 N_2 及び H_2 ガスの組合せを作動ガスとした。出力電流は600A~900Aの範囲において40~50kWの出力でプラズマを作動させた。ただし、個々の条件はセラミック材質系内ですべて一定とした。

また、作動条件と共に、粉体(溶射材)送給量、

溶射ガン走査速度及び溶射距離も同一材質内では一定にした。基材はSS-41もしくはSUS-304で、形状は50×150×3.2(mm)の一定形状とした。基材の事前処理としてはアルミニウムグリットでブラストし、アセトン液で洗浄した。さらにセラミック層(トップコート)被覆間にNiCrAlY系合金粉を下地溶射し、100~150μmのアンダーコート上に本発明法の材料、従来材料を溶射した。

熱処理法としては、基材加熱は電気炉もしくは基材抵抗加熱方式で実施し、溶射中あるいは皮膜表面加熱中に基材反対面の温度を維持するため、40~60°C/min量の Ar ガスでガス冷却した。皮膜表面の加熱は赤外線ヒーターを用いた。昇降温の調整は、非接触型の温度計での計測でヒーター出力を調整した。

また、得られた皮膜の密着力は、断面積2cm²のボルト(SS-41)をエポキシ樹脂で固定し、トルクレンチでねじり強さを測定した時のトルクでもって数値化し、従来法による皮膜の密着力指

数を100としてこれとの比で示した。

なお、従来法による皮膜は測定時、90%以上セラミック皮膜内で剥離し、本発明法の皮膜では測定時に85%以上セラミック層とアンダーコート界面で剥離した。

気孔量は上記測定で得られた剥離膜を、300°Cで樹脂を焼却することによって得られたものを用い、水銀圧入方式のボロシメーターで得られた積算気孔量で示した。従来法による皮膜の気孔量を100としてこれとの比で示した。ただし、サンプルの回収法から明らかのように実際の従来法の気孔量はボロシメーターで得られた数値より一様に多孔質と言える。

本発明による皮膜性状を従来例との対比で第1表~第3表に示す。これらの結果、密着力や緻密性の点で改善効果が著しく、膜内の結合力も向上していると容易に推定できる。

(その1(第1表))

金属 Zr 粉(純度:98%)を5~40μmの粒径に調整したものを配合量2~10vol%の割合

で ZrO_2 粉(純度:99%)に均一混合して溶射材料とし、 $Ar-H_2$ プラズマでSUS-304基材(下地処理後)に溶射し、厚さ500μmの被覆を施した。この結果、下記第1表に示す如く約20%量の気孔が軽減し、密着力が約2倍に向上した。

第1表

(本発明例)

項目		皮膜	①	②	③	④
溶射材料	金属粉 (外掛配合vol%)	Zr (5)	Zr (2)	Zr (10)	Zr (5)	
	セラミック粉	ZrO_2	ZrO_2	ZrO_2	ZrO_2	(*)
皮膜物相	主成分	ZrO_2	ZrO_2	ZrO_2	ZrO_2	
	副成分	Zr	Zr (tr)	Zr	Zr (tr)	
皮膜熱処理	皮膜表面温度(°C)					1100
	基材保熱温度(°C)					500
気孔量比		82	84	80	75	
密着力比		193	180	190	210	

*: Y_2O_3 4%

第 1 表

(従来例)

項目		皮膜	
溶射材料	金属粉 (外掛配合vol%)	①	②
	セラミック粉	ZrO ₂	ZrO ₂ (*)
皮膜の組物相	主成分	ZrO ₂	ZrO ₂
	副成分	—	—
皮膜の熱処理	皮膜表面温度(℃)	—	—
	基材保熱温度(℃)	—	—
気孔量比		100	96
密着力比		100	120

* : Y₂O₃ 4%

(その2(第2表))

金属Al粉(純度: 97%)を30~50μmの粒径に調整したものを、配合量を変えてAl₂O₃粉(通常ホワイトアルミナ)に均一混合して溶射材料とし、N₂-H₂プラズマでSS-41基材(下地

第 2 表

(本発明例)

項目		皮膜			
溶射材料	金属粉 (外掛配合vol%)	①	②	③	④
	セラミック粉	Al (5)	Al (5)	Al (10)	Al (5)
皮膜の組物相	主成分	Al ₂ O ₃			
	副成分	Al (tr)	Al		
皮膜の熱処理	皮膜表面温度(℃)	700			
	基材保熱温度(℃)	500			
気孔量比		70	80	75	90
密着力比		300	200	250	180

* : TiO₂ 2.4%

処理後)に溶射し、厚さ750μmの被覆を施した。

この結果、下記第2表に示す如く最大25%量の気孔軽減が認められ密着力が約2~3倍に向上了。更に、比較例として、2.4%TiO₂含有アルミナ(通常グレイアルミナ)及びTiO₂量13%でTiO₂-Al₂O₃(チタン酸アルミナ)を含むアルミナ系粉末について5vol%のAl粉を添加した材料による皮膜ではTiO₂量が多い場合緻密化するものの必ずしも密着力は向上しなかった。

また、一部熱処理を施した被覆サンプルでは密着力は著しく向上した。

第 2 表

(従来例・比較例)

項目		皮膜		(従来例)		(比較例)	
溶射材料	金属粉 (外掛配合vol%)	①	②	③	④	⑤	⑥
	セラミック粉	Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃ (*)	Al (5)	Al-Mn 合金 (5)
皮膜の組物相	主成分	Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Al ₂ O ₃			
	副成分	Al (tr)	Al			☆	☆☆
皮膜の熱処理	皮膜表面温度(℃)	700				700	—
	基材保熱温度(℃)	500				500	—
気孔量比		100	95	97	90		
密着力比		100	120	105	98		

* : TiO₂ 13% ☆ : Al₂O₃ · TiO₂
☆☆ : Al₂O₃ · MnO

(その3(第3表))

純度が91.3%以上のCr粉、Ti粉、Ni粉で5~50μmに調整したものを配合量2vol%の割合でCr₂O₃粉、TiO₂粉に均一混合して溶射材料とし、

SS-41 基材(下地処理)に溶射し、厚さ150~200μmの被覆を施した。

この結果、下記第3表に示す如く気孔量が約20%軽減し、約2倍の密着力向上が認められた。

第3表

(本発明例)

項目		皮膜		
		①	②	③
溶射材料	金属粉 (外掛配合vol%)	Cr (2)	Ti (2)	Ni (2)
	セラミック粉	Cr ₂ O ₃	TiO ₂	NiO
皮膜鉱物相	主成分	Cr ₂ O ₃	TiO ₂	NiO
	副成分	Cr	Ti (tr)	Ni
皮膜の熱処理	皮膜表面温度(℃)	500	500	500
	基材保熱温度(℃)	300	300	300
気孔量比	85	80	83	
密着力比	193	205	190	

第3表

(比較例)

項目		皮膜		
		①	②	③
溶射材料	金属粉 (外掛配合vol%)	—	—	—
	セラミック粉	Cr ₂ O ₃	TiO ₂	NiO
皮膜鉱物相	主成分	Cr ₂ O ₃	TiO ₂	NiO
	副成分	—	—	—
皮膜の熱処理	皮膜表面温度(℃)	200	200	200
	基材保熱温度(℃)	—	—	—
気孔量比	100	100	100	
密着力比	100	100	100	

以上、本発明を実施例に則して種々説明したが、本発明の範囲内で種々の変更および改良を行ない得ることは当業者には明白である。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明は、Al₂O₃、ZrO₂、

Cr₂O₃、TiO₂もしくはNiO系の酸化物単体のセラミック粉末に、酸化物中の陽イオンと同一の金属元素粉末を、前記セラミック粉末100vol%に対して1~10vol%添加して成るセラミック溶射材料及び事前処理を含む一連のセラミック溶射過程において、Al₂O₃、ZrO₂、Cr₂O₃、TiO₂もしくはNiO系の酸化物単体のセラミック粉末に、酸化物中の陽イオンと同一の金属元素粉末を、前記セラミック粉末100vol%に対して1~10vol%添加して成るセラミック溶射材料の溶射時あるいは/及び溶射直後に基材を550~200℃に保持しつつ、皮膜表面を1300℃未満で一旦加熱処理するものである為、皮膜の良好な結合状態が得られて密着力が良好となる。したがって、本発明によれば、耐熱性を著しく損うことなく、密着力が良好で長寿命の被覆が達成でき、緻密化と結合力向上によって被覆、機能が向上でき、しかも熱処理によってさらに緻密で耐熱性の優れたセラミック被覆が達成できる等益するところ大なる発明である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明によるセラミック溶射皮膜の積層形態(断面)図、第2図~第6図は従来例1~従来例5によるセラミック溶射皮膜の積層形態(断面)図である。

1はセラミック層、2は基材、3はアンダーコート層、10は疑似サーメット層。

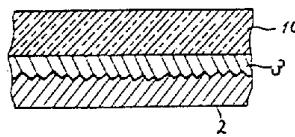
特許出願人 住友金属工業株式会社

代理人 溝上満

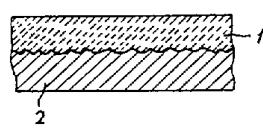
(ほか1名)



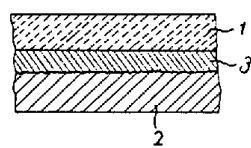
第1図



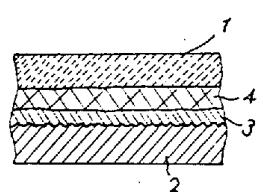
第2図



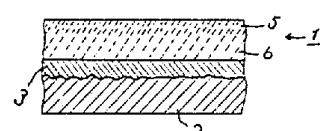
第3図



第4図



第5図



第6図



PAT-NO: JP362297451A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62297451 A
TITLE: CERAMIC MATERIAL FOR THERMAL
SPRAYING AND THERMAL
SPRAYING METHOD
PUBN-DATE: December 24, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
NARITA, YUJI	
SUZUKI, TAKAO	

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
SUMITOMO METAL IND LTD	N/A

APPL-NO: JP61141186

APPL-DATE: June 16, 1986

INT-CL (IPC): C23C004/04 , C23C004/18

US-CL-CURRENT: 427/427

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the heat resistance and adhesion of a formed film when a ceramic material obtd. by blending Al₂O₃, ZrO₂, Cr₂O₃ or NiO with a prescribed percentage of the same metallic element as the cation in the oxide is thermally sprayed,

by keeping a base material at a prescribed temp. and heating the surface of the resulting film to a prescribed temp.

CONSTITUTION: Powder of Al₂O₃, ZrO₂, Cr₂O₃ or NiO and powder of the same metallic element as the cation in the oxide are prep'd. and 1~10vol% of the metallic element powder is added to 100vol% of the oxide ceramic powder to obtain a ceramic material for thermal spraying. When the ceramic material is thermally sprayed, a base material is kept at 550~200°C and the surface of the resulting film is heated once to <1,300°C during and/or immediately after the spraying.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO&Japio